This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

.

XP-002256334

CH2

```
1987:85925 CAPLUS
   AN
       - 106:85925
   DN
       - Neutron-shielding transparent resin
       - Ida, Kozo; Azegami, Kyotaka
- Mitsubishi Rayon Co., Ltd., Japan
   IN
   PA
       - Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 4 pp.
         CODEN: JKXXAF
  DT
        Patent
  LА
       - Japanese
  FAN.CNT 1
         PATENT NO.
                      KIND DATE
                                      APPLICATION NO.
                                                         DATE
                         A. 19860925 JP 1985-56108
  PN - JP61215610
                                                         19850322
  PR - JP 1985-56108
                                 19850322
  AB - Hydroxyalkyl or glycidyl (meth)acrylates are treated with H3BO3, its
         esters, or BOx and polymd. to give the title resins, contg. 0.2-6% B.
         Thus, 3 mol 2-hydroxyethyl methacrylate and 1 mol H3BO3 were esterified 3
         h at 80.degree. and polymd. to a polymer with neutron shielding 1200% of
         that of poly (Me methacrylate).
  IT
        106946-68-3
                          106946-69-4
                                           106946-70-7
        RL: USES (Uses)
           (neutron shields, manuf. of transparent)
     - 106946-68-3 CAPLUS
        2-Propenoic acid, 2-methyl-, borylidynetris(oxy-2,1-ethanediyl) ester,
        homopolymer (9CI) (CA INDEX NAME)
     CM
     CRN.
           42175-72-4
     CMF
          C18 H27 B 09
            H2C
        Me....C ...C ....O....CH2.....CH2 ..
                C ...O ....CH2.....CH2.....O ...B..
                                                       ...C....CH2.....CH2
       CH2
Page _l_A
         CH2
Page 1-B
     106946-69-4 CAPLUS
     2-Propenoic acid, 2-methyl-, borylidynetris(oxy-2,1-ethanediyl) ester, polymer with ethenylbenzene (9CI) (CA INDEX NAME)
     CM
          1
     CRN
          42175-72-4
          C18 H27 B O9
     CME
           H2C
                 ...C ....O....CH2.....CH2 ..
                 ...O ....CH2......CH2.....O ...B....O....CH2......CH2 .....O
```

```
Page 1-A
    0
         CH2
....C....C....Me
Page 1-B
     CM
     CRN
         100-42-5
     CMF
          C8 H8
H2C ::::::::CH .....Ph
    106946-70-7 CAPLUS
     2-Propenoic acid, 2-methyl-, borylidynetris(oxy-2,1-ethanediyl) ester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate (9CI) (CA INDEX NAME)
CN
          42175-72-4
     CRN
          C18 H27 B O9
     CMF
           H2C
        Me....C ...C ....O....CH2.....CH2 ....O.
Me....C .....C ...O ....CH2......O ...B....O....CH2......O
       CH2
Page 1-A
    0
         CH2.
....C....C....Me
Page 1-B
     CM · -.2
     CRN 80-62-6
     CMF C5 H8 02
   H2C:
Me ....C:....C....OMe
IT
    *** 42175-72-4P***
     RL: SPN (Synthetic preparation); PREP (Preparation)
        (prepn. of)
    42175-72-4 CAPLUS
      2-Propenoic acid, 2-methyl-, borylidynetris(oxy-2,1-ethanediyl) ester
      (9CI) (CA INDEX NAME)
             H2C
         Me....C ...C ....O....CH2.....CH2 ....O.
 Me.....C .....C ....O .....CH2......O ...B.....O....CH2.
        CH2
```

O CH2

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-215610

@Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)9月25日

C 08 F 230/06

8319-4J

審査請求、未請求 発明の数 2 (全4頁)

❷発明の名称

中性子捕捉透明樹脂材料及びその製造法

②特 願 昭60-56108

②出 願 昭60(1985) 3月22日

⑫発 明 者 井 田

浩 三

大竹市御幸町12-1 三菱レイヨン株式会社内

⑫発 明 者 畔 上

清 孝

大竹市御幸町12-1 三菱レイヨン株式会社内

⑪出 願 人 三菱レイヨン株式会社

東京都中央区京橋2丁目3番19号

砂代 理 人 弁理士 小林 正雄

明 細 書

発明の名称

中性子補捉透明樹脂材料及びその製造法

特許請求の範囲

1. 一般式

$$R_1$$

 $CH_2 = C - COO - R_2 - X - O \frac{1}{n} B - OR_3 = 0$

(式中 R₁ は水素原子又は炭素数 1 ~ 3 の炭化水 素残基、 R₂ は炭素数 2 ~ 6 の炭化水素残基、 R₃ は水素原子又はエステル残基、 X は直接結合又 は基 - CH - CH₂ - 、 n は 1 ~ 3 の整数を示す) OH

で表わされる分子中に少なくとも1個の(メタ) アクリロキン基を有するホウ素含有(メタ)ア クリレートの単独重合体又は該単量体と共重合 しうる他の単量体との共重合体を主成分とする 樹脂組成物であつて、ホウ素の含有量が全樹脂 組成物に対して0.2~6.0 重量%であることを 特徴とする中性子補促透明樹脂材料。

- 2 ホウ酸、酸化ホウ素又はホウ酸エステルから 選ばれるホウ素化合物を、ヒドロキシアルキル (メタ)アクリレートと反応させて得られるホウ素含有(メタ)アクリレートの(共)重合体 を主成分とする、特許請求の範囲第1項に記載 の中性子捕捉透明樹脂材料。
- 3. ホウ酸、酸化ホウ素又はホウ酸エステルから 選ばれるホウ素化合物を、グリンジル(メタ) アクリレートと反応させて得られるホウ素含有 (メタ)アクリレートの(共)重合体を主成分 とする、特許請求の範囲第1項に記載の中性子 補捉透明樹脂材料。
- 4. 質量数 1 0 の同位体ホウ素を 1 5.0 %以上含有することを特徴とする、特許請求の範囲第 1 ~ 3 項に記載の中性子補捉透明樹脂材料。
- 5. 一般式

$$(CH_2 = C - COO - R_2 - X - O \rightarrow n - B - (OR_3)_3 - n$$

(式中 Ria は水素原子又は炭素数 1~3の炭化水

--95---

特開昭61~215610(2)

素残基、R₂は炭素数 2 ~ 6 の炭化水素残基、R₃ は水素原子又はエステル残基、X は直接結合又 は基 - CH - CH₂ - 、n は 1 ~ 3 の整数を示す) OH

で表わされる分子中に少なくとも1個の(メタ) アクリロキシ基を有するホウ素含有(メタ)ア クリレート又は該単量体と共重合しうる他の単 量体との混合物を2枚の鋳型板とその周囲に設 けたガスケットから構成されるセルの中に注入 して鋳込重合を行うことを特徴とする、中性子 捕捉透明樹脂材料の製造法。

発明の詳細な説明

本発明は、ホウ素を高い濃度で含有する中性子補捉用の透明な樹脂材料に関する。

ホウ素を含有する樹脂組成物としては、ポリエチレンにホウ素化合物を混合した樹脂組成物が知られている(特開昭 5 7 - 1 5 1 8 9 7 号、特開昭 5 6 - 1 2 2 8 4 8 号、特開昭 5 6 - 1 3 1 6 4 9 号、特開昭 5 6 - 1 3 3 3 4 9 号及

コールから形成されるか酸エステルを混合の増加に伴い、機械的性質及び透明性を損うたるなり、本り素合量は4重量%が上限にすぎないの、条明者のは、このような状況に鑑み、機械的性の人の大力素を高濃度に受れかった。

本発明は、一般式

$$R_1$$
(CH₂ = C - COO - R₂ - X - O) n B - (OR₃)₃ - n

(式中 R₁ は水素原子又は炭素数 1~3の炭化水素要基、R₂ は炭素数 2~6の炭化水素要基、R₃ は水素原子又はエステル残基、Xは直接結合又は基-CH-CH₂-、nは1~3の整数を示す)

で表わされる分子中に少なくとも 1 個の (メ タ) ア ク リ ロ キ シ 基 を 有 す る ホ ウ 素 含 有 (メ タ) ア ク リ レ ー ト の 単独 重 合 体 又 は 該 単 量 体 と 共 重 合

び特開昭 5 7 - 1 5 1 8 7 9 号等の公報参照)。 しかしこれらはいずれも基材樹脂と無機ホウ素 化合物を混合しているため、光学的に不透明材 料であり、用途が限定されている。一方、有機 ホウ素化合物を透明ブラスチックに可溶化させ たホウ素含有透明プラスチックも知られている。 例えば特公昭46131847号公報には、多 価アルコールをホウ酸と反応させて得られる界 面活性有機ホウ素化合物の製法が記載され、こ のホウ素化合物をポリメチルメタクリレートに 配合すると、帯電防止性を付与できることが示 されている。しかしこの方法では、界面活性剤 を使用するため、ポリマー中のホウ素の含有量 は 0.05~0.67重量%である。特開昭 55-144597号公報には、多価アルコールから 形成されるホウ酸エステルを含有するアルキル メタクリレート又はスチレンの重合体から成る 中性子線遮蔽材料が記載されている。この遮蔽 材料は、透明プラスチックであるアクリル樹脂 ヤスチレン樹脂を基材として、これに多価アル

し 5 る他の単量体との共重合体を主成分とする 樹脂組成物であつて、ホウ素の含有量が全樹脂 組成物に対して 0.2 ~ 6.0 重量 % であることを 特徴とする中性子捕捉透明樹脂材料である。

従来はホウ酸エステル化合物を(メタ)アクリレートあるいはスチレンに相容させ、これを重合し透明な樹脂組成物を得ていたが、本発明の樹脂材料は、ホウ素を分子中に含有する(メタ)アクリレートの(共)重合体であり、機械的性質及び透明性が優れている。

ホウ素含有(メタ)アクリレートは、例えば ホウ素化合物をアルコール性水酸基又はに シ基を有する(メタ)アクリレートと反応に ることにより得られる(特開昭 5 7 ー 1 3 7 3 7 2 号公報参照)。ホウ素化合物としてはホウ 酸、サアルキルが用いられる。質量数 1 0 の同 位体ホウ素を 1 5.0 %以上含有するホウ衆化合 物を用いることが好ましい。

アルコール性水酸基を有する(メタ)アクリ

特開昭61-215610 (3)

レートとしては、 2 ーヒドロキシエチルメタクリレート、 2 ーヒドロキシエチルアクリレート、 2 ーヒドロキシブロビルメタクリレート、 2 ーヒドロキシブロビルアクリレートなど、エポキシ基を有する (メタ)アクリレート としてはグリシジルメタクリレート、グリシジルアクリレートなどが用いられる。

アルコール性水酸基又はエポキン基を有する(メタ)アクリレートの使用量は、例えばホウ酸1モルに対し、1~3モルが好ましい。(メタ)アクリレートの量がこれより少ないと、目的の樹脂組成物の透明性が損なわれる。また(メタ)アクリレートの最かこれより多いと、ホウ素含有(メタ)アクリレートの収率が低下する。

ホウ素含有(メタ)アクリレートを他の単量体と共重合させる場合は、相容性の点から、ロが3であるホウ素含有(メタ)アクリレートのを用いることが好ましい。またロが1又は2の場合には、非重合性のアルコール性水酸基又は

から構成された型の中に注入し、鋳込重合を行 うことが好ましい。2枚の平行な鋳型板として は、鏡面硝子又は鏡面金属板が用いられる。

第込重合は常法により、アソビス系、パーオキサイド系等のラジカル重合開始剤又は光照射することにより行われる。重合に際しては必要に応じ、耐熱安定剤、紫外線吸収剤、離型剤等を添加することもできる。また樹脂組成物の用途に応じて、ィ線吸収能力の大きいBa、Pb、Bi等の元素、シンチレーター物質、蛍光体等を添加してもよい。

本発明の樹脂材料は、ホウ素の熱中性子に対する核反応性に由来する種々の機能を利用して、熱中性子の遮蔽、検出、中性子線ラジオグラフィなでに用いられる。

非重合性のエポキシ基含有化合物でエステル化 したものを用いてもよい。

本発明の中性子捕捉透明樹脂材料を製造するに際しては、前記のホウ素含有(メタ)アクリレート又はこれと他の単量体の混合物を、2枚の平行な鋳型板とその周囲に設けたガスケット

実施例 1

フラスコに2ーヒドロキシエチルメタクリレート3モル(3908)及びホウ酸1モル(628)を入れ、80℃で3時間攪拌下に反応させた。 次いで減圧下に生成水を549除去し、 無色透明なホウ素含有メタクリレート3988 を得た。このホウ素含有メタクリレートは、赤外スペクトルから、ホウ酸1分子中に3個のアルコールがエステルを形成していることが確認された。

このホウ素含有メタクリレート100gに、2,2'ーアゾビスー(2,4 ージメチルバレロニトリル)0.03g及び離型剤としてジオクチルスルホサクシネート・ナトリウム塩0.005gを添加し、溶解させたのち、脱気し、板厚が5粒となるよう設定されたステンレススチール製造なるようでで強型でくる5℃の強型では130分間浸漉したのち、120℃の空気浴に120分間滞在させて重合を完結させた。

鋳型から取り出した樹脂板はアクリル樹脂板

持開昭61-215610(4)

と同じく無色透明であつた。得られた樹脂組成物中のホウ素の含有量は2.8 重量%、全光線透過率(ASTM-D1003-61)は92%、曲げ破壊強度(ASTM-D790-63)は5.40kg/cm²、熱中性子に対する遮蔽能力は、熱中性子源として²³²cfを用いた場合、比較例により得られた樹脂板の12倍を示した(線源に対し試料で遮蔽したときと遮蔽しないときのBPカウンター値の比)。

奥施例 2

実施例 1 で得られたホウ素含有メタクリレート 8 0 g にメチルメタクリレート 2 0 g 、 2.2'ープ ゾビスー(2.4ージメチルバレロニトリル) 0.0 3 g 及び離型剤としてジオクチルスルホサクシネート・ナトリウム塩 0.0 0 5 g を添加、 容解させたのち、実施例 1 と同様に鋳込重合を実施した。

舞型から取出した樹脂板はアクリル樹脂板と同じく無色、透明であつた。得られた樹脂組成物中のホウ素の含有量は22重量%、全光線透

有メタクリレート38158を得た。

赤外スペクトルの結果、得られたホウ素含有メタクリレートにおいてはメチル基が3個とも メタクリロキシエチル基にエステル交換してい ることが確認された。

こうして得られたホウ素含有メタクリレート を用いて実施例1と同様に重合し、熱中性子に 対する遮蔽能力の大きい無色透明の樹脂板を得 た。

実施例 5

機拌装置及び冷却コンデンサーを付したフラスコ中に、トルエン 5 0 0 ml、グリシジルメタクリレート 4 モル(5 6 8 8)、水 1.1 モル(1 9 8 9)及び酸化ホウ素 1 モル(6 9 8)を入れて、トルエンを選流させながら 2 時間 反応させた。次いで減圧下にトルエン及び過剰の水を留去して無色透明な重合性ホウ素化合物を得た。このホウ素化合物 1 0 0 9 に対し、アゾビスー(2.4 ージメチルパレロニトリル) 0.0 5 9 及び維型剤としてジオクチルスルホサクシネ

過率は 9 2 %、曲げ破壊強度は 7 2 0 kg / cm²、熱中性子に対する遮蔽能力は比較例の樹脂板の 8 倍であつた。

奥施例 3

実施例 1 で得られたホウ素含有メタクリレート 8 0 g にスチレン 2 0 g 、 アゾビスパレロニトリル 0.0 5 g 及びジオクチルスルホサクシネート・ナトリウム塩 0.0 0 5 g を添加、 容解させ、実施例 1 を同様に鋳込重合を実施した。

鋳型から取出した樹脂板はアクリル樹脂板と同じく無色透明であつた。得られた樹脂組成物中のホウ素の含有量は22重量%、全光線透過率は90%、曲げ破壊強度は650kg/cm²であつた。

実施例 4

フラスコに2-ヒドロキシエチルメタクリレートるモル(390g)及びホウ酸トリメチル 1モル(55.5g)を入れ、60℃で3時間提 拌下に反応させた。次いで減圧下に生成したメ タノールを64g除去し、無色透明なホウ素含

ート・ナトリウム塩 0.0 0 5 g を添加し、容解 させたのち、実施例 1 と同様にして重合し、熱 中性子遮蔽能力の大きな樹脂板を得た。

比較例

メチルメタクリレート 1 0 0 g に 2,2'ーアゾビスー(2,4 ージメチルバレロニトリル) 0.0 3 g 及びジオクチルスルホサクシネート・ナトリウム塩 0.0 0 5 g を添加し容解させたのち、実施例 1 と同様に鋳込重合を実施し、アクリル樹脂板を得た。この樹脂板の全光線透過率は 9 2 %、曲げ破壊強度は 1 0 5 0 kg / cm² であつた。

出願人 三変レイョン株式会社 代理人 弁理士小 林 正 雄